PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

07-206442

(43)Date of publication of application: 08.08.1995

(51)Int.CI.

CO1G 25/00

(21)Application number: 06-005996

(71)Applicant: TOKYO OHKA KOGYO CO LTD

(22)Date of filing:

24.01.1994

(72)Inventor: HASHIMOTO AKIRA

(54) COATING SOLUTION FOR FORMING MULTIPLE OXIDE OF ZIRCONIUM AND ITS **PRODUCTION**

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain a coating soln. easily forming a multiple oxide of zirconium by uniformly dissolving diacylated zirconic acid hydrate and soluble salts of metals constituting the multiple oxide and other than zirconium.

CONSTITUTION: Diacylated zirconic acid hydrate (A) represented by the formula (where R is lower alkyl) and soluble salts (B) of metals (e.g. alkali metals, alkaline earth metals, Al, Si, Ti, Bi and Pb) constituting a multiple oxide of zirconium to be formed and other than zirconium are uniformly dissolved in a solvent such as water, alcohol, ketone or ether. The amt. of the component Bused is 0.1-5 equivs, per 1 equiv. of zirconium. A soluble polymer (C) may further be dissolved by 1-100 pts.wt. per 100 pts.wt., in total, of the components A, B. The objective coating soln, is obtd.

$$H^{\odot} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & H_{2} & 0 \\ \| & & & \| & \| \\ R - C - 0 - Z & f - 0 - C - R \\ H_{2} & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{\odot}$$

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-206442

(43)公開日 平成7年(1995)8月8日

(51) Int.Cl.⁸

識別記号 广内整理番号

FΙ

技術表示箇所

C 0 1 G 25/00

審査請求 未請求 請求項の数6 OL (全 7 頁)

(21)出顧番号

特顧平6-5996

(71)出願人 000220239

(22)出願日

平成6年(1994)1月24日

東京応化工業株式会社 神奈川県川崎市中原区中丸子150番地

(72)発明者 橋本 晃

神奈川県川崎市中原区中丸子150番地 東

京応化工業株式会社内

(74)代理人 弁理士 阿形 明 (外1名)

(54) 【発明の名称】 ジルコニウム系複合酸化物形成用盤布液及びその製造方法

(57)【要約】

【構成】 (A) ジアシレートジルコニウム酸水和物、例えば一般式

【化1】

$$H^{\oplus} \begin{bmatrix} O & O & OH_{1} & O \\ || & || & || & || \\ R - C - O - Z & r - O - C - R \\ || & || & || \\ H_{1}O & OH \end{bmatrix}^{\ominus}$$

(式中のRは低級アルキル基)で表わされる化合物と、

(B) ジルコニウム系複合酸化物を構成するジルコニウム以外の金属の可溶性塩及び、場合により(C)可溶性ポリマーを均一に溶解した溶液から成るジルコニウム系複合酸化物形成用塗布液とその製造方法である。

【効果】 従来調製困難であった、ジルコニウム系複合酸化物被膜形成用塗布液を安定した状態のものとして提供することができる。この塗布液は、クラックのない均一な被膜を基板上に形成しうる。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 (A) ジアシレートジルコニウム酸水和物と、(B) ジルコニウム系複合酸化物を構成するジルコニウム以外の金属の可溶性塩とを均一に溶解した溶液から成るジルコニウム系複合酸化物形成用塗布液。

【請求項2】 (A) ジアシレートジルコニウム酸水和物と、(B) ジルコニウム系複合酸化物を構成するジルコニウム以外の金属の可溶性塩と、(C) 可溶性ポリマーとを均一に溶解した溶液から成るジルコニウム系複合酸化物形成用塗布液。

【請求項3】 (A) 成分のジアシレートジルコニウム 酸水和物が、一般式

【化1】

(式中のRは低級アルキル基である)で表わされる化合物である請求項1又は2記載のジルコニウム系複合酸化 20物形成用途布液。

【請求項4】 (B) 成分中のジルコニウム以外の金属がアルカリ金属、アルカリ土類金属、Al、Si、Ti、Bi、Pb、La、Cu、Ni、Y、Ce、Mo、W、Fe、Ge及びZnの中から選ばれた少なくとも1種の金属である請求項1,2又は3記載のジルコニウム系複合酸化物形成用塗布液。

【請求項5】 一般式

$Zr(OR')_{+}$

(式中のR'はアルキル基であって、4個のR'はたが 30 いに異なっていても同一でもよい)で表わされるテトラアルコキシジルコニウム又はその錯体化合物に、溶媒の存在下又は不存在下で、一般式

R-COOH

(式中のRは低級アルキル基である)で表わされるカルボン酸を反応させたのち、さらに水を付加させ、次いでこの反応生成物と、ジルコニウム系複合酸化物を構成するジルコニウム以外の金属の可溶性塩とを溶媒の存在下で混合することを特徴とするジルコニウム系複合酸化物形成用塗布液の製造方法。

【請求項6】 一般式

Zr(OR')

(式中のR'はアルキル基であって、4個のR'はたがいに異なっていても同一でもよい)で表わされるテトラアルコキシジルコニウム又はその錯体化合物に、溶媒の存在下又は不存在下で、一般式

R-COOH

(式中のRは低級アルキル基である)で表わされるカル 合物とともに親油性溶媒中に溶解して塗布することが行が、 かれているが [「ジャーナル・オブ・アプライド・ファニの反応生成物と、ジルコニウム系複合酸化物を構成す 50 ジックス (J. Appl. Phys.)」,第70巻,

るジルコニウム以外の金属の可溶性塩と、可溶性ポリマーとを溶媒の存在下で混合することを特徴とするジルコニウム系複合酸化物形成用塗布液の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、複合金属酸化物被膜を 形成するための、安定な塗布液及びその製造方法に関す るものである。さらに詳しくいえば、本発明は、ケイ 素、ガラス、セラミックス、金属などの基板上に、絶縁 性、誘電性、圧電性、焦電性、電歪、電気光学的性質を 示す複合金属酸化物被膜を形成するのに用いられる安定 な塗布液及びその製造方法に関するものである。

[0002]

【従来の技術】電子部品、半導体素子、光学材料等において、絶縁膜、誘電体被膜、圧電体被膜、焦電体被膜、電気光学的被膜、半導体メモリーのキャパシタ、金属酸化物高温超電導被膜などを形成するため、スパッタ法、CVD法、ゾル・ゲル塗布法、MOD法、レーザーアブレーション法、水熱電気化学法等が用いられ、また種々の塗布液が知られている。

【0003】これらの被膜形成法の中で、ゾル・ゲル塗 布法は、量産性、コスト低減化、複合金属酸化物被膜中 の化学量論的コントロールの容易性の点で優れているの で注目されている。この方法により、PZT被膜 [РЬ (Zr, Ti)O₃系被膜]やPLZT被膜[(Pb, La) (Zr, Ti) O₃系被膜] を形成させるのに用 いる塗布液を製造するには、Zr(OR)、やTi(O R) 』などの金属アルコキシドと酢酸鉛や酢酸ランタン などの酢酸金属塩とをアルコール系溶媒中で脱エステル 化反応させながら、メタロキサン結合を有する前駆体化 合物を形成させ、次いでこれを加水分解させることによ って行われる [R. Gurkovich外1、「Ult rastructure Processing of Ceramics, Glasses and Com posites」、第152ページ(1984年)、同 「J. Mater. Sci.」, 第20巻, 第4479 ページ(1985年)]。

【0004】このように、金属アルコキシドと酢酸金属塩との反応を利用するには、酢酸金属塩をアルコール系溶媒に溶解させる必要がある。しかしながら、BaTiOs、SrTiOs、(Ba, Sr)TiOs、Bi。TioOs、(Bi, Pb)(Ni, Ti)Os系被膜を形成させる場合は、原料化合物がアルコール系溶媒への溶解性を欠くため、この方法を用いることができない。【0005】一方、PZT系酸化被膜を形成させる場合に、高級脂肪酸のBa、Sr塩すなわち金属セッケンを用い、これをテトラアルコキシチタンのようなチタン化合物とともに親油性溶媒中に溶解して塗布することが行われているが[「ジャーナル・オブ・アプライド・フィジックス(Longle Parts)

第4号, 第2290~2298ページ (1991 年)]、これを用いて得られる塗膜は、その中の高級脂 肪酸が占める割合が大きいため、焼成時における収縮率 が大きく、密度の低下、膜圧の減少をもたらす上に、蒸 留しにくいため純粋なものにすることがむずかしく、実 用的な方法とはいえない。

【0006】また、2種以上の金属アルコキシドをアル コール溶媒中で還流させて複合アルコキシドを含む溶液 を形成させ塗布する方法も知られているが「「第10回 強誘電体応用会議、講演予稿集」、第55~56ペー ジ]、アルカリ土類金属のアルコキシドを用いる場合に は、アルコールに対する溶解度が小さく、生成した溶液 の安定性、再現性が不良であって、実用的でない。これ らの欠点を改善するために、ジエタノール変性を行うこ とも試みられているが、得られた溶液が空気中の二酸化 炭素を吸収して、不溶性の炭酸塩を析出したり、塗布液 をアルカリ性とするため焼成に際して高温を必要とする という欠点を伴う上に、結晶形成が不十分になるという 欠点もある。

【0007】さらに、チタン酸バリウム繊維の製造に際 20 して、酢酸バリウムの酢酸溶液に、テトラアルコキシチ タンを加え、加水分解する方法も知られているが [「ジ ャーナル・オブ・マテリアル・サイエンス (I. Mat er. Sci.)」, 第25巻、第3922~3929 ページ(1990年)]、酢酸ストロンチウムは酢酸に 対して難溶であるので、ストロンチウムを含む被膜を形 成する場合には利用できないし、また酢酸を溶媒とする 方法は一般に生産量や作業環境の点に問題があり、工業 的方法としては不適当とされている。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、これまで適 当な塗布液がなく、塗膜法により形成させることができ なかったジルコニウムと各種金属との複合酸化物を、容 易に形成しうる、保存安定性が良好な塗布液を提供する ことを目的としてなされたものである。

[0009]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、複合金属 酸化物被膜形成用の塗布液を開発するために鋭意研究を 重ね、先にテトラアルコキシチタンやその誘導体が乳酸 により親水化されること及び多くの金属の酢酸塩や硝酸 40 塩が乳酸に可溶であることに着目し、乳酸を媒質とする チタン系複合酸化物被膜形成用塗布液を提案した。

【0010】この塗布液を用いると、塗膜焼成後「AB O_x]型のペロブスカイト系複合酸化物が形成される が、上記の乳酸を用いる方法は、この酸化物のBサイト を構成する金属がチタンの場合には利用しうるが、ジル コニウムの場合には、ゲル化や沈殿生成を伴うので、B aZrO₃, SrZrO₃, (Pb, Ba) ZrO₃, (Pb, Ba) (Zr, Ti) O₁のようなジルコニウ ム系複合酸化物被膜を形成するめための塗布液に対して 50 用させることにより得ることができる。

は用いることができなかった。

【0011】そこで、さらにジルコニウム化合物の可溶 化について研究を続けた結果、テトラアルコキシジルコ ニウム又はその錯体化合物に、低級脂肪酸及び水を作用 させて得られるジアシレートジルコニウム酸水和物が水 溶性を有し、他の金属の酢酸塩及び硝酸塩のような水溶 性塩と水性媒質中でよく混和しうることを見出し、この 知見に基づいて、本発明をなすに至った。

【0012】すなわち、本発明は、(A) ジアシレート 10 ジルコニウム酸水和物と、(B) ジルコニウム系複合酸 化物を構成するジルコニウム以外の金属の可溶性塩及び 場合により(C)可溶性ポリマーとを均一に溶解した溶 液から成るジルコニウム系複合酸化物形成用塗布液を提 供するものである。

【0013】前記ジアシレートジルコニウム酸水和物 は、例えば一般式

$Zr(OR')_{+}$ (I)

(式中のR'は低級アルキル基であって、4個のR'は たがいに同一でも異なっていてもよい)で表わされるテ トラアルコキシジルコニウム又はその錯体化合物に、酢 酸、プロピオン酸、酪酸のような低級脂肪酸を反応させ たのち、水を付加させることによって製造することがで きる。本発明においては、この完全水和物と同様に部分 水和物を用いることができるが、特に

【化2】

$$H^{\bigoplus} \left[\begin{array}{cccc} O & O & OH_{2} & O \\ \parallel & & \swarrow & \parallel \\ R - C - O - Z & r - O - C - R \\ & \uparrow & \uparrow \\ & H_{2}O & OH \end{array} \right]^{\bigoplus}$$

(式中のRは低級アルキル基である)で表わされる化合 物が好適に用いられる。

【0014】この一般式(I)で表わされるテトラアル コキシジルコニウムの例としては、テトラメトキシジル コニウム、テトラエトキシジルコニウム、テトラプロポ キシジルコニウム、テトラブトキシジルコニウム、テト ラペントキシジルコニウム、テトラヘキソキシジルコニ ウム、トリメトキシエトキシジルコニウム、ジメトキシ ジエトキシジルコニウム、ジメトキシジプロポキシジル コニウム、ジエトキシジプロポキシジルコニウム、トリ エトキシブトキシジルコニウム、ジエトキシジブトキシ ジルコニウムなどを挙げることができる。これらは、単 独で用いてもよいし、また2種以上混合して用いてもよ 11

【0015】ジアシレートジルコニウム酸水和物は、上 記のテトラアルコキシジルコニウム1モル当り、少なく とも1モル好ましくは2~4モルの酢酸を反応させたの ち、さらにその生成物に、その中のジルコニウム1当量 当り、少なくとも1モル好ましくは2~4モルの水を作

【0016】上記のテトラアルコキシジルコニウムと酢酸との反応の代わりに、可溶性の金属酢酸塩、例えば酢酸鉛、酢酸バリウム、酢酸ランタン、酢酸亜鉛などを、酢酸の供給源として用い反応させることもできる。このようにすると、ジルコニウムと複合させる他の金属も同時に供給されるので有利である。

【0017】テトラアルコキシジルコニウムと酢酸又は 金属酢酸塩との反応は、溶媒の存在下で行うこともでき る。この際の溶媒としては、例えばアルコール類、ケト ン類、ジエチレングリコールモノアルキルエーテル類な 10 どの水混和性溶媒が用いられる。

【0018】また、本発明の塗布液では、上記のテトラアルコキシジルコニウムの代わりに、テトラアルコキシジルコニウムとβ・ジケトン化合物又は多価アルコール化合物を反応させて得られるテトラアルコキシジルコニウムの錯体化合物を用いることもできる。

【0019】この場合、使用されるテトラアルコキシジ ルコニウムは、上記と同様のものが挙げられる。また、 β-ジケトン化合物としては、例えばアセチルアセト ン、トリフルオロアセチルアセトン、ヘキサフルオロア セチルアセトン、ベンゾイルアセトン、ベンゾイルトリ フルオロアセトン、ジベンゾイルメタン、アセト酢酸メ チルエステル、アセト酢酸エチルエステル、アセト酢酸 ブチルエステルなどが挙げられる。これらは単独でも、 また2種以上混合して用いてもよい。このβ-ジケトン 化合物として好ましいものは、アセト酢酸メチルエステ ル、アセト酢酸エチルエステル、アセト酢酸ブチルエス テルである。また、多価アルコール化合物としては、例 えばエチレングリコール、トリエチレングリコール、プ ロピレングリコール、ジプロピレングリコール、ブタン ジオール、ヘキシレングリコール、オクチレングリコー ル、グリセリン、グリセリルアセテート、グリセリルモ ノブチレート、トリメチロールプロパン、グリセリルモ ノアクリレート、グリセリルモノメタクリレートなどを 挙げることができる。これらの多価アルコール化合物は 単独でも、2種以上混合して用いてもよい。

【0020】テトラアルコキシジルコニウムの錯体化合物は、上記したテトラアルコキシジルコニウム1モルに対し、上記した β -ジケトン化合物又は多価アルコール化合物を $1\sim2$ モルの割合で反応させたものが好ましく使用できる。そして、この反応は有機溶媒中で行ってもよく、またテトラアルコキシジルコニウムを有機溶媒中に溶解して得られた溶液に β -ジケトン化合物又は多価アルコール化合物を添加して反応させてもよい。

【0021】次に、本発明において用いる、ジルコニウム系複合酸化物を構成するジルコニウム以外の金属としてはアルカリ金属、アルカリ土類金属、Al、Si、Ti、Bi、Pb、La、Cu、Ni、Y、Ce、Mo、W、Fe、Ge、Znなどがある。

【0022】これらの金属は、可溶性塩の形で用いられ 50 レングリコールジエチルエーテル、テトラヒドロフラ

るが、このような可溶性塩としては、上記金属の有機カルボン酸塩や硝酸塩を使用することができ、例えばBa (CH₃COO)₂nH₂O、La (CH₃COO)₃nH₂O、Pb (CH₃COO)₂nH₂O、Li (CH₃COO)₃nH₂O、Sr (CH₃COO)₂nH₂O、Y (CH₃COO)₃nH₂O、Mg (CH₃COO)₂nH₂O、Y (CH₃COO)₃nH₂O、Mg (CH₃COO)₂nH₂O、La (NO₃)₃nH₂O、Pb (NO₃)₂nH₂O、Li (NO₃)₃nH₂O、Pb (NO₃)₂nH₂O、Li (NO₃)₃nH₂O、Mg (NO₃)₂nH₂O、Sr (NO₃)₂nH₂O、Zn (NO₃)₂nH₂O、Y (NO₃)₃nH₂O、Zn (NO₃)₂nH₂O、Y (NO₃)₃nH₂O、Zn (NO₃)₂nH₂O、Y (NO₃)₃nH₂O などの硝酸塩が好適に使用される。これらの可溶性塩は、単独で用いてもよいし、2種以上組み合わせて用いてもよい。

【0023】本発明の塗布液が混合系の場合、(A)成分と(B)成分との使用割合は、所望の複合金属酸化物中の各金属の原子比に応じて定められるが、通常、ジルコニウム1当量当り、それ以外の金属の合計量0.1~5当量好ましくは0.2~3当量の範囲内で選ばれる。【0024】本発明の塗布液は、(A)成分と(B)成分とを所定の割合で適当な溶媒中に溶解するか、(A)成分を含む溶液に(B)成分を加え溶解させるか、

(A) 成分を、(B) 成分の存在下で形成させ、その反応生成物を適当な溶媒で希釈するか、あるいは(A) 成分を含む溶液と(B) 成分を含む溶液を別々に調製しておき、両者を混合することにより製造することができる。

【0025】本発明の溶媒としては、水、アルコール 類、多価アルコール類、ケトン類、β-ジケトン類、エ ーテル類などが好ましい。このアルコール類としては、 メタノール、エタノール、プロパノール、イソプロパノ ール、n - ブタノール、ペンタノール、ヘキサノール、 シクロヘキサノール、エチレングリコールモノメチルエ ーテル、エチレングリコールモノエチルエーテル、エチ レングリコールモノプロピルエーテル、エチレングリコ ールモノブチルエーテル、エチレングリコールモノアセ テート、プロピレングリコールモノメチルエーテル、プ ロピレングリコールモノエチルエーテル、プロピレング リコールモノプロピルエーテル、プロピレングリコール モノブチルエーテル、乳酸メチル、乳酸エチルなどが、 多価アルコールとしては、エチレングリコール、ジエチ レングリコール、プロピレングリコール、ジプロピレン グリコール、ブタンジオール、ヘキシレングリコールな どが、ケトン類としては、アセトン、メチルエチルケト ン、ジアセトンアルコールなどが、β - ジケトン類とし ては、アセチルアセトン、アセト酢酸メチル、アセト酢 酸エチル、C-メチル-アセチルアセトン、マロン酸エ ステルなどが、エーテル類としては、エチレングリコー ルジメチルエーテル、ジエチレングリコールジメチルエ ーテル、エチレングリコールジエチルエーテル、ジエチ

ン、ジオキサンなどを挙げることができる。これらの溶 剤は単独で用いてもよいし、2種以上混合して用いても よい。

【0026】本発明においては、所望に応じ、これらの 成分に加えて、厚膜性の塗膜の形成を容易にするため に、さらに(C)成分として可溶性特にアルコール可溶 性のポリマーを配合することができる。このような可溶 性ポリマーとしては、その分子構造中に水酸基を有する もの、例えば部分けん化したポリ酢酸ビニル、ポリビニ ルアルコール、ホルマール樹脂、ブチラール樹脂、アセ 10 タール樹脂、セルロース、ポリグリセリンなど、あるい は2-ヒドロキシメチルアクリレート、2-ヒドロキシ メチルメタクリレート、2-ヒドロキシエチルアクリレ ート、2 - ヒドロキシエチルメタクリレート、2 - ヒド ロキシプロピルアクリレート、2 - ヒドロキシプロピル メタクリレート、2-ヒドロキシブチルアクリレート、 2 - ヒドロキシブチルメタクリレートなどの水酸基をも つモノマーの単独重合体及び共重合体を挙げることがで きる。そのほか、ポリビニルピロリドンのような可溶性 ポリマーも用いることができる。

【0027】これらの可溶性ポリマーは、塗布液中に含 まれる(A)成分と(B)成分の合計量100重量部当 り1~100重量部の範囲内で配合される。この量が1 重量部未満のものでは、1回の塗布で厚膜の塗膜を形成 することが困難になるし、100重量部よりも多くなる と、形成されるジルコニウム系複合酸化物の物性が若干 低下する傾向があるので、実用上10~40重量部の範 囲が適当である。

【0028】本発明の塗布液は、所定の有機溶剤中に、 (A) 成分、あるいは (A) 成分と (B) 成分との混合 30 物、特に高度の塗膜性が要求される場合には、(C)成 分を、全固形成分濃度が5~50重量%の範囲になるよ うに溶解し、十分に分散させたものがよい。

【0029】このようにして得られた本発明の塗布液 は、プラスチックス、ガラス、セラミックス、金属ナイ トライドや金属カーボネートなどの粉末を焼成して得ら れた基板、金属、半導体基板などに塗布され、加熱する ことで均一性に優れた複合金属酸化物被膜を形成するこ とができる。この場合の塗布手段としては浸漬引き上げ 法、スプレー法、スピンコート法、刷毛塗り法、ロール 40 コート法、印刷法、減圧吹付け法(LSCUD法)のい ずれの方法でも用いることができる。また加熱手段とし てはホットプレート加熱、熱風加熱、バーナー加熱、赤 外線加熱、レーザー加熱、高周波加熱、急速加熱法(R TA法)などを挙げることができる。加熱温度は250 ℃以上、好ましくは350℃以上で化学的に安定した被 膜を形成することができるが、基板の材質などにより制 限を受けるので、基板が耐えられる温度内で適宜選択す る必要がある。

[0030]

【発明の効果】本発明は、従来調製困難とされたジルコ ニウム系の複合金属酸化物被膜形成用塗布液を与え、こ の塗布液は保存安定性に優れ、クラックのない均一な被 膜を基板上に形成でき、1回の塗布により、特に(C) 成分を含有させたもので、容易に所望の膜厚の被膜を形 成しうるという利点を有するので、基板上に上記した種 々の特性をもつセラミックス膜を形成させるのに好適で

[0031]

ある。

【実施例】次に実施例により本発明をさらに詳細に説明 する。

【0032】実施例1

テトラプロポキシジルコニウム327.6g(1.0モ ル) をエチレングリコールモノメチルエーテル700g に溶解し、酢酸240g(4.0モル)を少量づつ滴下 し反応させる。次いで純水72g(4.0モル)を同様 に滴下混合したのち、エチレングリコール248.3g (4.0モル)を加えて溶解させてA液を調製した。

【0033】乳酸360g(1.0モル)をエチレング リコールモノメチルエーテル1250gと混合し、室温 で酢酸バリウム255.4g(1.0モル)を1~12 時間かけて滴下し溶解させてB液を調製した。上記A液 とB液とを混合し、30分かきまぜて均一化し、2r-Ba系複合酸化物被膜形成用塗布液を得た。このものは 透明で、1か月経過後も安定であった。

【0034】次いで、3インチシリコンウエーハ上に、 この塗布液をスピンナーで、2000rpmの回転数で 塗布して得た塗布膜を、空気中、100℃で30分、3 00℃で30分、650℃で30分焼成して膜厚104 O Åのクラックのない均一なBaZrO₃被膜を得た。 また、回転数をそれぞれ4000rpm及び6000r pmに変えた以外は同様にして膜厚がそれぞれ800Å 及び640Åのクラックのない均一なBaZrO₃被膜 を得た。

【0035】実施例2

酢酸鉛3水和物379.3g (1.0モル) を80℃に 加熱されたエチレングリコールモノメチルエーテル37 5gに溶解し、120℃まで昇温し、脱水させたのち、 80℃まで降温させた。次いで、テトラプロポキシジル コニウム327.6g(1.0モル)を滴下し、124 ℃まで昇温し、脱エステル化し、Pb-O-Zr結合を 有する前駆溶液を生成させ637.8gまで濃縮したの ち、室温まで冷却後、エチレングリコールモノメチルエ ーテル2100gに溶解し、酢酸240g(4.0モ ル)を少量づつ滴下し、1時間かきまぜた。次いで、純 水36g(2.0モル)を同様に滴下しかきまぜたの ち、プロピレングリコール302.5g(4.0モル) を加え1時間かきまぜて2r-Pb系複合酸化物被膜形 成用塗布液を調製した。このものは透明で、1か月経過

50 後も異常は認められず安定であった。

【0036】次いで、3インチシリコンウエーハ上に、この塗布液をスピンナーで、4000 r p mの回転数で塗布して得た塗布膜を、空気中、100 $\mathbb C$ 、300 $\mathbb C$ 及び650 $\mathbb C$ でそれぞれ30 分焼成して膜厚740 $\mathbb A$ のクラックのない均一な $\mathbb P$ b $\mathbb Z$ r $\mathbb O_3$ 被膜を得た。また、回転数を6000 r p mに変えた以外は同様にして膜厚が620 $\mathbb A$ のクラックのない均一な被膜を形成させた。

【0037】 実施例3

酢酸鉛 3 水和物 1 8 9. 7 g (0.5 モル)を80℃に加熱されたエチレングリコールモノメチルエーテル 18 10 7.5 g に溶解し、120℃まで昇温し、脱水したのち、80℃まで降温させた。次いで、テトラプロポキシジルコニウム 3 2 7.6 g (1.0 モル)を滴下し、124℃まで昇温し、脱エステル化し、476.4 g まで濃縮し、Pb-O-Z r 結合を有する前駆溶液を得た。次いで、エチレングリコールモノメチルエーテル 500 g を加えてかきまぜ、酢酸 240 g (4.0 モル)を少しづつ滴下し反応させたのち、純水 36 g (2.0 モル)を同様に滴下しかきまぜたのち、プロピレングリコール 302.5 g (4.0 モル)を加え 1 時間かきまぜ 20 て A 液を調製した。

【0038】乳酸360g(4.0モル)をエチレングリコールモノメチルエーテル1350gと混合し、室温で酢酸バリウム127.7g(0.5モル)を2時間かけて滴下し溶解させてB液を調製した。上記A液とB液とを混合し、30分かきまぜて均一化し、Zr-Pb-Ba系複合酸化物被膜形成用塗布液を得た。このものは透明で、1か月経過後も異常は認められず安定であった。

【0039】次いで、3インチシリコンウエーハ上に、この塗布液をスピンナーで、2000 r p mの回転数で塗布して得た塗布膜を、空気中、100℃、400℃及び650℃でそれぞれ30分焼成して膜厚1050Åのクラックのない均一な被膜を形成させた。また、回転数をそれぞれ4000 r p m及び6000 r p mに変えた以外は同様にして膜厚がそれぞれ800Å及び660Åのクラックのない均一な(PbessBaess)ZrOss被膜を得た。

【0040】実施例4

酢酸鉛 3 水和物 1 8 9. 7 g(0.5 モル)を 8 0 ℃に 40 加熱 されたエチレングリコールモノメチルエーテル 1 8 7. 5 g に溶解し、1 2 0 ℃まで昇温し、脱水したのち、8 0 ℃まで降温させた。次いで、テトラプロポキシジルコニウム 1 7 0.3 g(0.5 2 モル)とテトラブトキシチタニウム 1 6 3. 4 g(0.4 8 モル)の混合物を滴下し、1 2 4 ℃まで昇温し、脱エステル化し、6 2 5 g まで濃縮し、P b - O - Z r、P b - O - T i、T i - O - P b - O - Z r 等のメタロキサン結合を有する前駆溶液を調製した。次いで、この前駆溶液を室温まで冷却し、n - プロピルアルコール 5 0 O g を加えてか 50

きまぜ、酢酸 240g (4.0 モル)を少しづつ滴下し 1 時間かきまぜて反応させたのち、純水 36g (2.0 モル)を滴下し 1 時間かきまぜたのち、プロピレングリコール 456.6g を加え 1 時間かきまぜて A 液を調製した。

10

【0041】乳酸360g(4.0+ル)をn-プロピルアルコール500gと混合し、酢酸バリウム127.7g(0.5+ル)を2時間かけて滴下し溶解させてB液を調製した。上記A液とB液とを混合し、30分かきまぜて均一化し、2r-Pb-Ba-Ti系複合酸化物被膜形成用塗布液を得た。このものは透明で、1か月経過後も異常は認められず、安定であった。

【0042】次いで、3インチシリコンウエーハ上に、この塗布液をスピンナーで、2000 r p mの回転数で塗布して得た塗布膜を、空気中、150 $\mathbb C$ 、300 $\mathbb C$ 及び 700 $\mathbb C$ でそれぞれ 30分焼成処理を行うことにより、膜厚 1700 Åのクラックのない均一な被膜を形成させた。また、回転数をそれぞれ 4000 r p m 及び 6000 r p m に変えた以外は同様にして膜厚がそれぞれ 1200 Å及び 1000 Åのクラックのない均一な [(Pbos Baos) Zros Tios 10, 被膜を得た。

【0043】 実施例5

【0044】エチレングリコールモノメチルエーテルにヒドロキシエチルメタクリレートモノマー20重量%を溶解し、重合開始剤のアゾビスイソブチロニトリル3重量%を加え、50℃で4時間重合させたのち、100℃まで昇温し失活させてポリヒドロキシエチルメタクリレートを20重量%含有する樹脂溶液を調製した。この樹脂溶液 860 gを、乳酸 360 g(4.0 モル)とエチレングリコールモノメチルエーテル500 gの混合物に加えて均一にかきまぜたのち、酢酸バリウム 204 g(0.8 モル)を2 時間かけて滴下し溶解させて B 液との力になり一化し、B を B で B で B を B で B を B で B を B で

【0045】次いで、3インチシリコンウエーハ上に、この塗布液をスピンナーで、2000 r p mの回転数で塗布して得た塗布膜を、空気中、300 $^{\circ}$ 及び650 $^{\circ}$ でそれぞれ30分焼成処理を行うことにより、膜厚3500Åのクラックのない均一な被膜を形成させた。また、回転数をそれぞれ4000 r p mに変えた以外は同様にして膜厚がそれぞれ2500Å及び2200Åのクラックのない均一な(Pb_{0.2} Ba_{0.8}) Z r O₃ 被膜を得た。

【0046】実施例6

テトラプロポキシジルコニウム372.6g(1.0年ル)とアセト酢酸メチルエステル116g(1.0年ル)とを混合し、80で30分間かきまぜながら反応させることでテトラプロポキシジルコニウムの錯体化合物を生成したのち、エチレングリコールモノメチルエーテル700gを加え、さらに酢酸120g(2.0年

ル)を少しづつ滴下し反応させた。次いで、純水 7 2 g (4.0 モル)を同様に滴下し混合したのち、、エチレングリコール 2 4 8.3 g (4.0 モル)を加えて溶解させてA液を調製した。乳酸 3 6 0 g (1.0 モル)をエチレングリコールモノメチルエーテル 1 2 5 0 g と混合し、室温で酢酸バリウム 2 5 5.4 g (1.0 モル)を1~1 2時間かけて滴下し溶解させてB液を調製した。上記A液とB液とを混合し、30分間かきまぜてりった。上記A液とB液とを混合し、30分間かきまぜをであった。次いで、3 インチシリコンウエーハトに、この塗布液は透明で、1カ月過ぎても異常は起こらず安定であった。次いで、3 インチシリコンウエーハトに、塗布液をスピンナーで2000 r p mの回転数でで30分、650℃で30分焼成して膜厚1100Åのクラックのない均一なBaZrO。被膜を得た。

12